

最先端リソグラフィプロセス用5 nm フィルター

ウルチプリーツ・P-ナイロン

■ 欠陥レベルの低減

- 厚みのある膜構造 → コンタクトタイム増加とソフトゲル除去率向上
- 金ナノ粒子によるフィルターろ過精度設定 → 微細ナノレベル・コンタミ除去

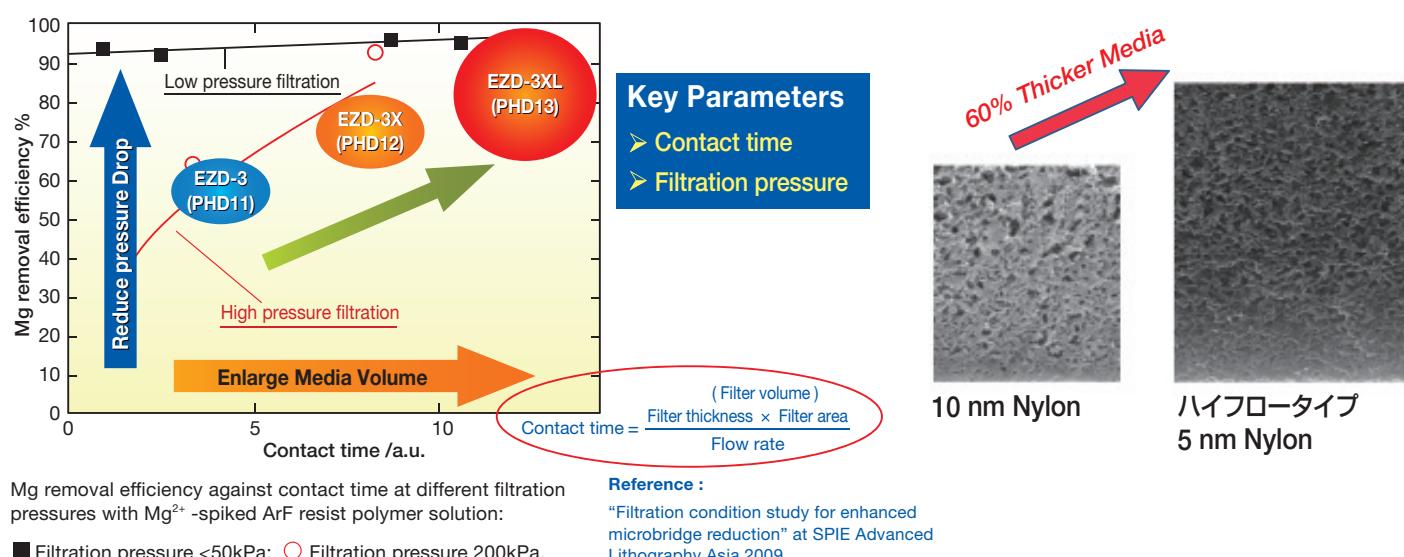
■ フィルター寿命の延長

- ハイフロータイプ膜 → 初期圧力損失の低減

■ フィルター立ち上げ時間短縮と廃棄薬液の低減

- Xpress(特殊洗浄)処理 → フィルター初期清浄度を改善

ナイロン膜の吸着性能の向上

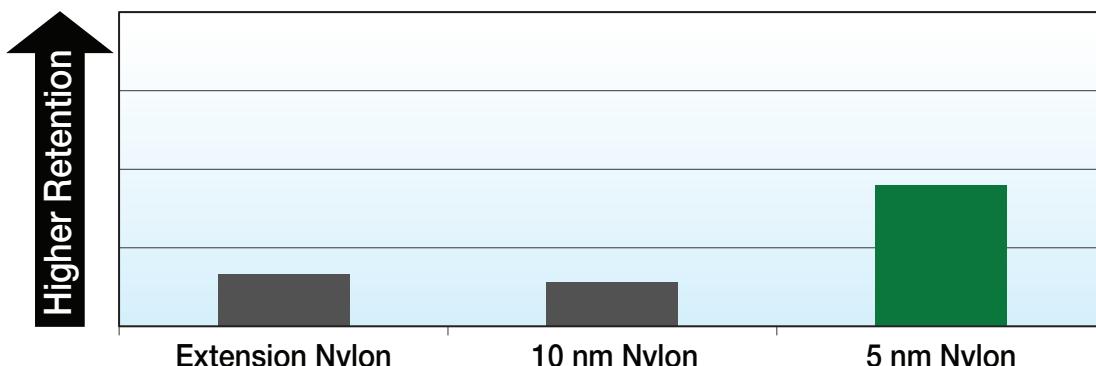


Mg removal efficiency against contact time at different filtration pressures with Mg²⁺ -spiked ArF resist polymer solution:

■ Filtration pressure <50kPa; ○ Filtration pressure 200kPa.

ろ過精度の改善

5 nm Gold Nano-Particle (GNP)

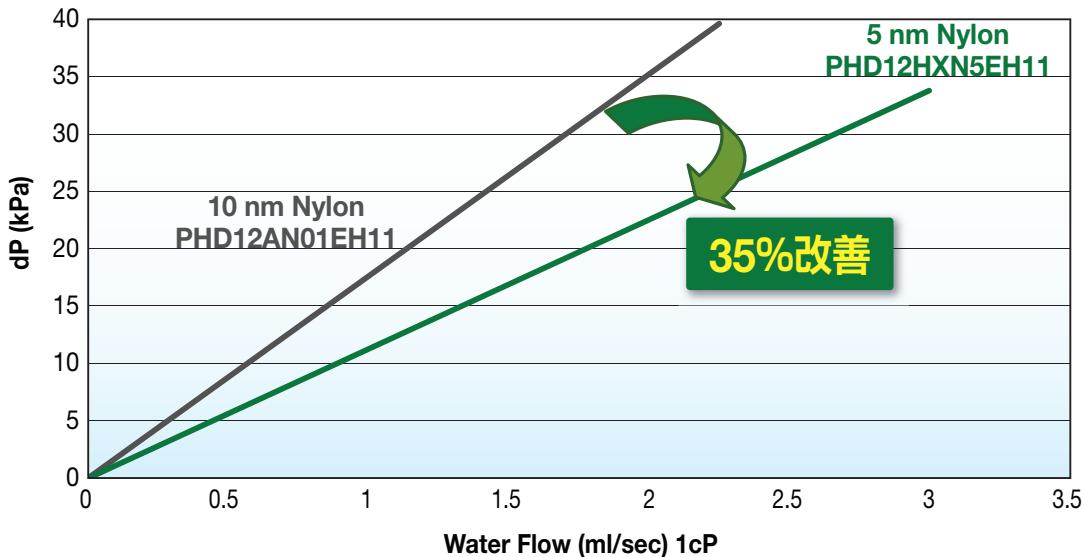


最先端リソグラフィプロセス用5 nmフィルター

ウルチプリーツ・P-ナイロン

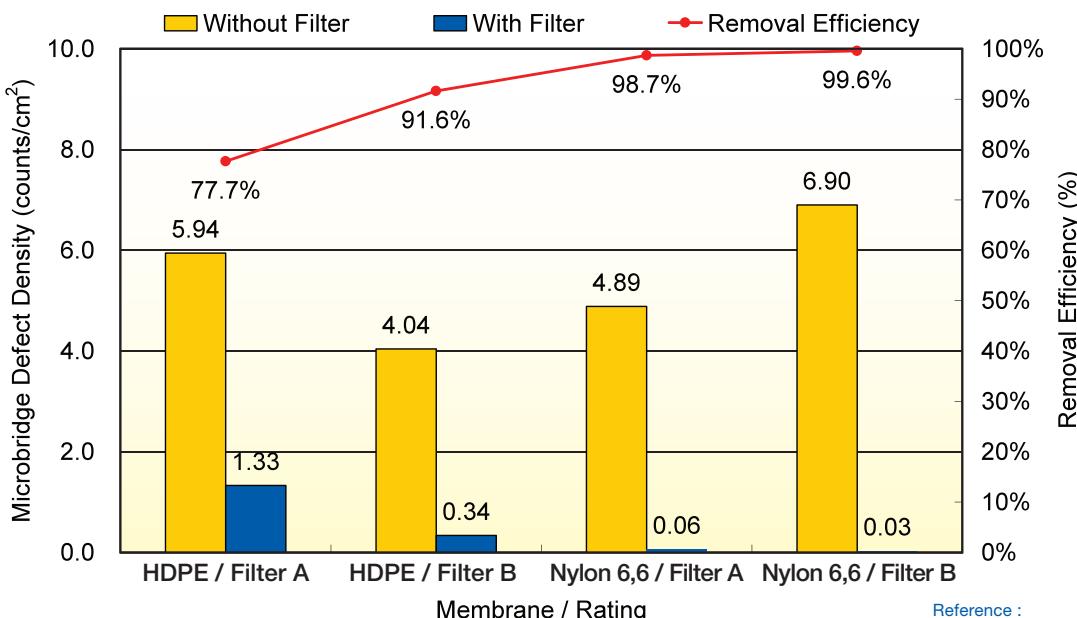
初期圧力損失の低減

フォトクリーンEZD2Xカプセル



ウェハー上の欠陥低減

ブリッジ欠陥の低減



Reference :
 "Defect Reduction by using Point-of-use
 Filtration in a New Coater/Developer"
 at SPIE Advanced Lithography 2009.

お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】TEL.03-6901-5700